

日本ガイシの新規事業創出戦略：共創施設を核とした事業変革への挑戦

要約

日本ガイシは2025年5月に完成予定の「共創施設」を核として、新規事業創出の加速を図っている。同社は「NGKグループビジョンRoad to 2050」のもと、「New Value 1000」戦略を推進し、2030年までに新事業化品売上高1,000億円以上を目指している。カーボンニュートラルとデジタル社会の2分野に重点投資し、絶縁放熱回路基板や有機化合物結晶探索サービスなどの事業化に成功している。競合他社と比較すると、日本ガイシは比較的保守的なアプローチを取っているものの、セラミック技術を基盤とした差別化戦略により、着実な成長を目指している。

1. 日本ガイシの新施設概要

1.1 共創施設の概要

日本ガイシは2023年11月に、オープンイノベーションの推進を目的とした「共創施設」の建設を発表した^[1]。この施設は2025年5月に完成予定で、新規事業創出の拠点として位置づけられている。

施設の主な特徴：

- 目的: オープンイノベーション推進とグループアイデンティティ浸透
- 機能: 社外との協働拡大、新たな挑戦意欲の醸成
- 設計コンセプト: 「遊び心」「ボーダーレスな空間」「外部への発信」「自由闊達・尖った」

1.2 施設の構成要素

主要エリア：

- 社会課題解決に貢献する製品・コア技術紹介エリア
- 社外とのアイディエーション実施エリア
- 社内外の出会い・交流創出エリア
- NGKの歴史・価値観に触れる誇りと挑戦マインド醸成エリア

2. 新規事業創出の長期戦略

2.1 NGKグループビジョンRoad to 2050

日本ガイシは2021年4月に「NGKグループビジョンRoad to 2050」を策定し、独自のセラミック技術でカーボンニュートラル（CN）とデジタル社会（DS）に貢献することを「ありたい姿」として掲げている。

事業構成転換の目標：

- 2030年：CN/DS関連売上高比率50%
- 2050年：CN/DS関連売上高比率80%

2.2 New Value 1000（NV1000）戦略

主要目標：

- 2030年度：新事業化品売上高1,000億円以上
- 研究開発投資：10年間で3,000億円（CN・DS分野に80%配分）

組織体制の強化：

- NV推進本部の設置（マーケティング機能強化）
- 2024年4月：エンバイロメント事業本部にCN事業推進部新設
- 新研究開発棟建設（DS関連製品開発推進）

3. 重点分野とターゲット技術

3.1 カーボンニュートラル（CN）分野

主要技術・製品：

DAC（Direct Air Capture）用セラミックス

- 大気中CO₂の直接回収技術
- ハニカム構造体とCO₂吸着材の最適組み合わせ
- 2030年頃の量産化を目指す

サブナノセラミック膜

- 分子レベルでの気体・液体分離
- 用途：CO₂分離、原油増産、e-Fuel製造
- 2023年よりChitoseグループと共同開発

NAS®電池

- メガワット級電力貯蔵システム
- 再生可能エネルギー安定化用途で需要拡大

3.2 デジタル社会（DS）分野

主要技術・製品：

半導体製造装置用セラミックス

- シリコンウェハー温度の均一制御
- 高温プラズマ・腐食性ガス環境での安定動作

高機能ウェハー

- 通信・モビリティセンサー用複合ウェハー
- 直接接合技術による高品質化

薄型・小型リチウムイオン二次電池EnerCera®

- ウェアラブル・医療機器向け
- 高エネルギー密度・長寿命を実現

4. 新規事業の成功事例と進捗

4.1 事業化成功事例

絶縁放熱回路基板

- 2019年から欧州・日本のパワー半導体メーカーで採用
- 2030年度売上目標：200億円
- 2026年度までに生産能力2.5倍増強予定

有機化合物結晶探索サービス

- 2024年4月事業開始
- 世界初の赤外線技術応用
- 2030年度売上目標：30億円

4.2 実証フェーズの製品群

期待売上約1,000億円規模：

- DAC用セラミックス
- 産業排ガスからのCO2分離
- EV用パワーモジュール放熱技術
- VPP（仮想発電所）サービス
- 電子デバイス高機能化技術

4.3 開発フェーズの製品群

期待売上約1,000億円規模：

- 水素・メタネーション関連技術
- 再生可能エネルギー関連技術
- 半導体・製造装置関連技術
- 次世代通信関連技術

5. 競合他社との比較分析

5.1 京セラの新規事業戦略

戦略概要：

- 2023年度初の3カ年中期経営計画発表
- 2025年度売上目標：2.5兆円
- 半導体関連事業に重点投資（設備投資・研究開発の約半分）

特徴：

- 大規模投資（3年間で1.2兆円）
- 半導体関連事業への集中投資
- 海外展開の積極化^[2]

5.2 村田製作所の新規事業戦略

戦略概要：

- 「η（イータ）プロジェクト」による人材育成・新規事業創出
- 2027年度売上目標：2兆円
- AI・データセンター関連に注力

特徴：

- 社員発信型の新規事業創出制度
- 700ページの新規事業開発方法論構築
- セラミックコンデンサ研究開発センター設立（投資額350億円）^[3] ^[4]

5.3 TDKの新規事業戦略

戦略概要：

- 長期ビジョン「TDK Transformation」
- 2027年度売上目標：2.5兆円
- 戦略投資を従来の3倍（1,500億円）に拡大

特徴：

- M&A重視の成長戦略
- 未財務資本の強化
- コーポレートベンチャーキャピタル活用（Fund 3で1.5億ドル）^[5] ^[6] ^[7]

5.4 日本ガイシの独自性

比較優位：

- 独自のセラミック技術を基盤とした差別化
- 100年超の技術蓄積
- 社会課題解決型の事業創出

課題：

- 投資規模が競合他社より小さい
- 新規事業創出のスピードが相対的に遅い
- 保守的な企業文化からの脱却が必要

6. 事業ポートフォリオへの影響と将来展望

6.1 事業ポートフォリオの変革

現在の事業構成（2023年度）：

- エンバイロメント事業：67%（3,940億円）
- デジタルソサエティ事業：24%（1,382億円）
- エネルギー&インダストリー事業：9%（470億円）

将来目標（2030年）：

- CN/DS関連事業の売上比率50%達成
- 新事業化品で1,000億円の売上創出

6.2 新規事業創出の加速要因

内部要因：

- 共創施設による社内外連携強化
- NV推進本部によるマーケティング機能強化
- 「新規事業提案プログラム」による社員参画促進

外部要因：

- カーボンニュートラル政策の世界的推進
- 半導体市場の長期成長（2030年までに2倍の1兆ドル規模）

- EVシフトによるパワー半導体需要拡大

6.3 潜在的な課題

技術面：

- 競合他社との技術開発競争激化
- 新規技術の事業化リスク
- スケールアップ時の技術的課題

市場面：

- 新規市場の不確実性
- 顧客開拓の困難さ
- 価格競争の激化

組織面：

- 保守的企業文化からの脱却
- 新規事業人材の確保・育成
- スピード感のある意思決定体制構築

7. 結論と提言

7.1 共創施設の戦略的意義

共創施設は日本ガイシの新規事業創出において、単なる物理的な拠点以上の意味を持つ。これまでの「内向き」「保守的」な企業文化を「外向き」「挑戦的」に変革する象徴的な施設として位置づけられている。

7.2 成功要因

短期的成功要因：

- 既存技術の応用による早期事業化
- 明確な売上目標設定（NV1000）
- 組織体制の強化

長期的成功要因：

- 社会課題解決型の事業創出
- 独自のセラミック技術による差別化
- オープンイノベーション推進

7.3 今後の展望

日本ガイシは共創施設を核として、従来の技術主導型から市場主導型への転換を図っている。競合他社と比較すると投資規模は小さいものの、100年超の技術蓄積と社会課題解決への強いコミットメントにより、着実な成長を実現する可能性が高い。

ただし、競争環境の激化と事業環境の急速な変化に対応するため、より迅速な意思決定と積極的な投資が求められる。共創施設が真に新規事業創出の起爆剤となるかは、今後の運営と活用次第であろう。

✻

1. <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000024407.html>
2. https://www.kyocera.co.jp/sustainability/catalog/pdf/2023/03_strategy.pdf
3. <https://corporate.murata.com/ja-jp/newsroom/news/company/general/2023/1106>
4. <https://www.mercenaire.jp/case/murata>
5. https://www.tdk.com/ja/ir/tdk_management_policy/policy/index.html
6. <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC21AWQ0R20C24A5000000/>
7. https://www.tdk.com/ja/news_center/press/20250421_02.html